

実験概要

直接検出型センサーを備えたGIF Continuum

タイトル

マルチパスその場スペクトラムイメージング法を用いた電子線照射に敏感なポリマー材料の相マッピング

Gatan社製使用装置

GIF Continuum® K3® およびモデル626一軸傾斜液体窒素クライオトランスファーホルダー

研究の背景

ブレンドポリマーの機能的な特性を理解し向上するために、ナノスケールで化学的な情報と相の情報を得ることは重要です。しかしながら、ポリ カーボネートのブレンドポリマーのような有機材料は電子線照射による分解のダメージに非常に敏感であり、EELSのスペクトラムイメージング 法を用いた研究が困難です[1]。直接検出型センサーの高い感度によって、炭素CのKエッジの吸収端の微細構造(ELNES)を検出するために必要 な総照射電子線量が抑えられ、高い分解能で有機材料から情報を得ることが可能となりました。DigitalMicrograph®ソフトウェアを用いたマル チパスその場スペクトラムイメージング法は、個々の保存されたフレームに総照射電子線を分割し、ダメージによって損なわれたフレームを除く ことが可能となります。本概要では、直接検出型センサーとマルチパスその場スペクトラムイメージング法を組み合わせることにより、電子線照 射に敏感なブレンドポリマーの相の情報を高い空間分解能で抽出可能となることを紹介します。

材料と測定手法

ポリカーボネート(PC)とポリ(スチレンーアクリロニトリル)(SAN)の75:25%ブレンドポリマーをモデル系として用い、直接検出型センサーによる 感度向上の評価を行いました。炭素CのKエッジのELNESの形状は、局所的な非占有状態密度が反映されています。そのため炭素の結合状態 の局所的な変化を研究するために用いられます。照射電子線量の増加に伴うELNESの変化を検討するため、マルチパスその場スペクトラムイメ ージング法を使用しました。この手法は総照射電子線量に対する炭素CのKエッジのELNESの形状変化を観察することが可能です。総照射電子 線量に対するSAN相とPC相から得られた炭素CのKエッジのELNESの変化を図1aとbに示します。SAN相から得られたCのKエッジのELNESの 変化は、電子線照射量の増加に対して僅かです。最も大きな変化はピークaに観られ、照射電子線量の増加と共にピーク強度が減少しています (図1a)。一方、PC相から得られたCのKエッジのELNESにはいくつかの明瞭な変化が観察されています。aとcのELNESのピークは照射電子線量 の増加と共に小さくなっていることが判りますが、一方ピークbは強度が大きくなっています(図1b)。CのKエッジの微細構造に変化が観察され たため、初めの2回のパスのみ保存しました。PC相とSAN相から抽出したCのKエッジのELNESをリファレンスとして用いて、DigitalMicrographソ フトウェアの定量のためのツールパレットを使用し選択した領域内のPCとSAN相の空間分布をマッピングしました(図1c)。1000 e⁻/nm²以上でC のKエッジのELNESに変化が観察され、同時に大きな介在物も見られます。



図1.ブレンドポリマー中の(a)SANと(b)ポリカーボネートから得られた、異なる照射電子 線量で取得した炭素CのKエッジ。(c)データ内から得られたELNESスタンダードを用いて 生成した総照射電子線量が1000 e /nm²時における相マップ



図2. (a) ブレンドポリマーのADF STEM像 (b) C Kエッジから得られたELNESのスタンダードを用いて生成した相マップ

まとめ

図1cと図2bに示すように、PC相とSAN相の分布の観察を行いました。25 nm/pixから20 nm/pixへと相マップの空間分解能は大幅に改善し、光学カップリング構造を有するCCDカメラを用いて観察を行った先の研究[1]と比較して必要な照射電子線量は約1/10になりました。Continuumの高性能の光学系とK3カメラの高いDQEを組み合わせることで、炭素CのKエッジのELNESのスペクトル構造を維持するのに 十分に低い照射電子線量で元素マップを得る能力が得られました。Gatan社のクライオ試料ホルダーと組み合わせることで、これまで分析が 不可能と考えられてきた電子線照射に敏感な他の材料に対してもEELSデータの取得が可能となります。

謝辞

Thanks to Robert Colby at ExxonMobil Technology and Engineering Company for sharing the samples, data, and feedback. [1] Colby R. et al., Ultramicroscopy **246** (2023) 113688

www.gatan.com

© 2023, by Gatan, Inc. All rights reserved. Gatan, Gatan logo, and all other trademarks are property of Gatan, Inc. unless otherwise specified

EB-DOSE-SENSITIVE-POLYMERS-FL1-NJ-APR23-JP